DIN 50453-2:2023-08 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen - Teil 2: Siliciumdioxid-Schichten, Optisches Verfahren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Begriffe ... 4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens ... 4
5 Geräte ... 4
6 Silicium-Substrat ... 5
7 Zusammensetzung der Ätzmischungen ... 5
8 Einflüsse auf das Messergebnis ... 5
8.1 Struktur der Siliciumdioxid-Schicht ... 5
8.2 Temperatur ... 5
8.3 Dotierung ... 5
9 Probenvorbereitung ... 5
10 Durchführung ... 5
11 Auswertung ... 7
12 Präzision des Verfahrens ... 7
13 Prüfbericht ... 8
Literaturhinweise ... 9

Bilder

Bild 1 — Prüfaufbau zur Bestimmung der Ätzrate von Ätzmischungen ... 6